



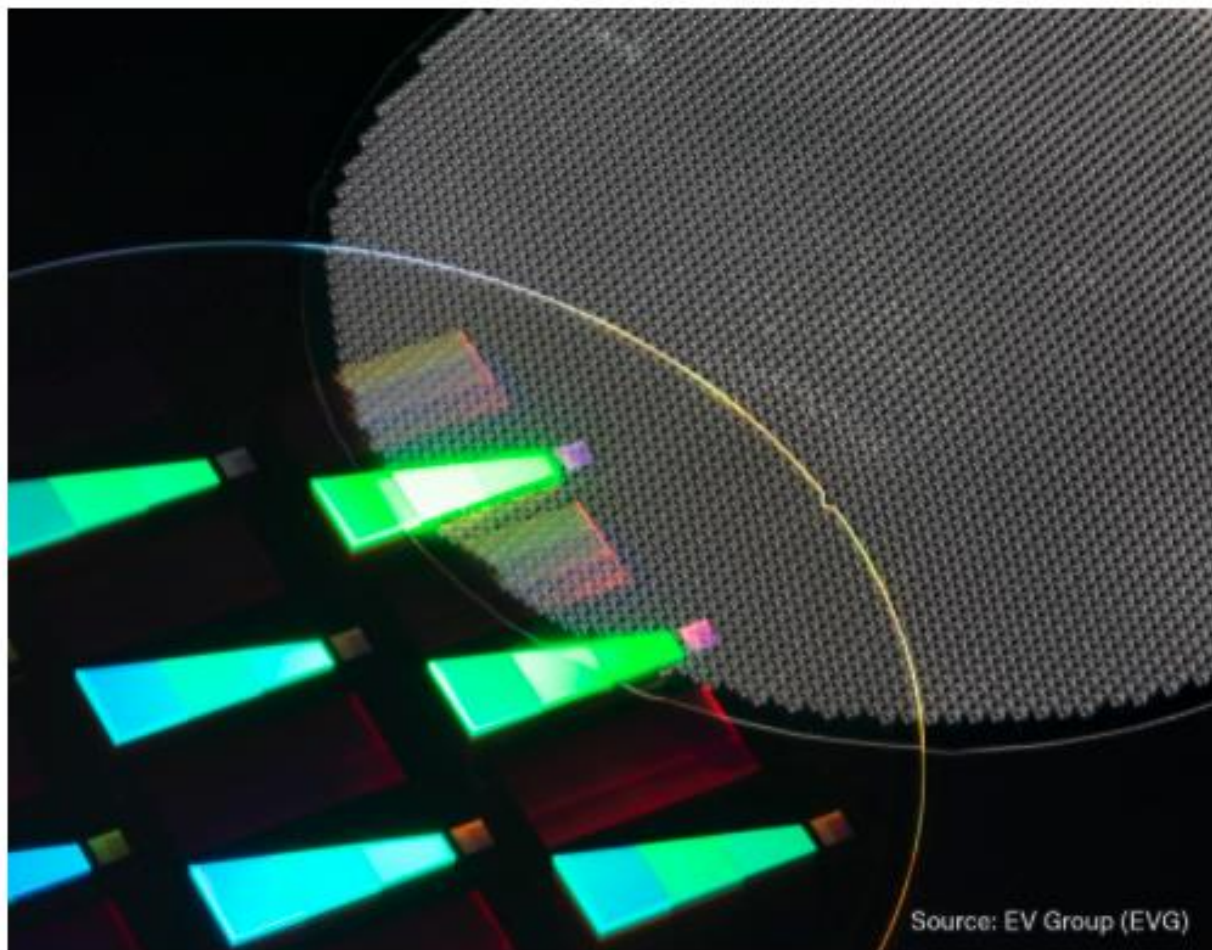
(Taiwan)

Meet the mass production of miniature optical components EVG multi-functional nano-imprinting solution unveiled – January 25, 2022

滿足微型光學元件量產 EVG多功能奈米壓印方案亮相

文·吳心予 發布日期：2022/01/26 關鍵字：[EV GROUP](#)、[EVG7300](#)、[UV](#)、[UV-NIL](#)

微機電系統(MEMS)、奈米科技與半導體市場的晶圓接合暨微影技術設備供應商EV Group(EVG)，日前推出EVG7300自動化SmartNIL奈米壓印與晶圓級光學系統。EVG7300是EVG先進的解決方案，可在單一平台上結合如奈米壓印微影技術(NIL)、透鏡壓鑄與透鏡堆疊(UV接合)等多重基於UV架構的製程。這套多功能系統，旨在滿足涉及各種微型和奈米圖案以及功能層堆疊等嶄新應用的先進研發與生產需求，包括晶圓級光學(WLO)、光學感測器與投影機、汽車照明、擴增實境頭戴式裝置使用的波導管、生物醫療設備、超穎透鏡(Meta-lens)與超穎介面(



SmartNIL結構化的擴增實境波導管和晶圓級微透鏡壓印展現了最新EVG7300的多功能應用特性(Meta-surface)等光電元件。

EV Group企業技術總監Thomas Glinsner表示，EV Group憑藉累積超過20年的奈米壓印技術經驗，持續作為引領此關鍵領域的技術先驅，開發各種創新的解決方案，以滿足客戶不斷變化的需求。我們最新推出的奈米壓印解決方案系列產品EVG7300，將SmartNIL全域壓印技術及透鏡壓鑄和透鏡堆疊結合成一套頂尖的系統，具備市場上較精確的對準與製程參數控制，為我們客戶的產業研究與生產需求提供彈性。

EVG7300既可作為獨立工具，也可當作一個模組整合在EVG的HERCULES NIL之中，作為UV奈米壓印微影(UV-NIL)的全整合解決方案，其中還可增加如清洗、光阻塗層，以及烘烤或後處理等額外的預處理步驟，以最佳化特定製程的需求。這套系統透過結合對準階段的改善、高精度光學元件、多點間隙控制、非接觸式間隙量測與多點力控制，具可達300奈米的對準精度。EVG7300是具高度彈性的平台，提供三種不同的製程模式，包含透鏡壓鑄、透鏡堆疊與SmartNIL奈米壓印，並支援150毫米到300毫米晶圓的基板尺寸。模板與晶圓的快速裝載、快速對準的光學元件、高功率固化以及極小的工具佔用空間，使這套高效平台能夠滿足業界對WLO產品的製造需求。

<https://www.mem.com.tw/arti.php?sn=2201250005>